ナノエマルション油滴中でのアルカンの異方的な結晶成長

Inhomogeneous crystalization of alkane in a nano emulsion oil droplet

川端庸平^{1,*},三好樹¹,岡田賢²,出口茂²,加藤直¹

1首都大学東京,〒192-0375 東京都八王子市南大沢 1-1

²海洋研究開発機構, 〒237-0061 神奈川県横須賀市 2-15

Youhei Kawabata^{1,*} Itsuki Miyoshi¹, Satoshi Okada², Shigeru Deguchi², and Tadashi Kato¹

¹ Tokyo Metropolitan Univ., 1-1 Minami-oosawa, Hachioji, 192-0397, Japan

²Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, 2-15 Natsushima, Yokosuka, 237-0061,

Japan

1 <u>はじめに</u>

水と油をエマルション(乳化物)として混合する 技術は、食品、医薬品、化粧品などの広範な産業分 野で応用されている。エマルションの応用で重要な 点は、エマルション粒径と安定性(均一性)である。 出口らのグループは、水の超臨界状態での炭化水 素との相溶性に注目し、超臨界水と炭化水素の均一 溶液を急冷し、平均 100 nm 以下の微細な油滴(ナ ノエマルション)を形成する新しい乳化手法 (MAGIO, Monodisperse nAnodroplet Generation In Quenched hydrothermal solution) を確立している[1]。 出口らのグループはさらに、この MAGIQ の乳化手 法を一般化するべく乳化物質適用範囲の拡大を目指 し、様々な物質での試験を行ってきた過程において、 ヘキサデカンを乳化物質とした場合に、ヘキサデカ ンの融点以下 4℃で保存すると、ヘキサデカンが異 方性をもって結晶成長し、板状の粒子を形成する現 象を見出した。これまでの広角 X 線散乱実験 (WAXS)の結果から、ヘキサデカンの準安定相で ある回転相の存在を示唆する結果を得ており、油滴 の微細化によって油水界面近傍に局在する回転相が 安定化し、大変形に関わったものと考えている。

そこで本研究では、エマルション油滴サイズがへ キサデカンの準安定回転相の形成に与える効果を明 らかにすることを目的とし、サイズの異なるエマル ションの冷却下での WAXS 測定を行った。

2 <u>実験</u>

1 vol%のヘキサデカンを油滴とし、非イオン性界 面活性剤(Brij97)5 mMの濃度となるように MAGIQによって油滴粒径95 nm ~ 1.2 μmの試料を 作成した。これらの試料は予め4℃で3ヶ月保存し、 厚さ1 mmの銅板に試料セルに詰めカプトンで挟ん で温調ステージ(TS62, Instec 社製)に固定して4℃ において WAXS 測定した。WAXS 測定はビームライ ン 6A で行った。

3 結果および考察

図1はエマルション試料の各粒径毎の WAXS プロ ファイルである。各試料ともヘキサデカンの結晶相



図1:各粒径のエマルションサンプルの WAXS プロファイル。

由来のピークが明瞭に現れた。波数 q=14 nm⁻¹ 近傍 の2つのピーク、16.5、17.5 nm⁻¹のピークはヘキサデ カン結晶相に特徴的なピークであるが、15 nm⁻¹のピ ークは粒径 95,120 nm の試料のみに現れ、146 nm ~ 1.2 µm の試料では極端にピーク強度が弱く明確なピ ークとして現れていない。篠原らによると、q=15 nm⁻¹のピークはヘキサデカン回転相由来のピークで あり、エマルション油滴の油水界面で回転相が安定 化した結果であると報告している [2]。従って、こ の結果は粒径の小さな油滴中ではヘキサデカンの結 晶相と共存し、少なくとも冷却から3ヶ月間は回転 相が安定化して存在し得ることを示すものである。 この回転相の安定化は油水界面の曲率によるもので あると推察している。粒径の小さなエマルションで は油水界面の曲率が大きく、界面活性剤疎水基に沿 って配向するヘキサデカン分子は平行に並ぶことが 困難である。従って、粒径が小さい油滴中では大き な界面曲率によってヘキサデカンの結晶化が抑えら れたものと考えている。

参考文献

 S. Deguchi, N. Ifuku, Angew. Chem. Int. Ed. 52, 6409-6412 (2013).

[2]Y. Shinohara et al., Phys. Rev. Lett. 94, 097801 (2005).

* youheik@tmu.ac.jp